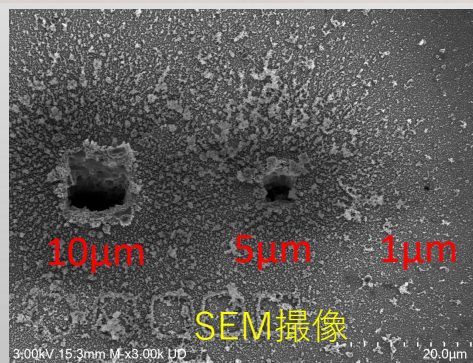
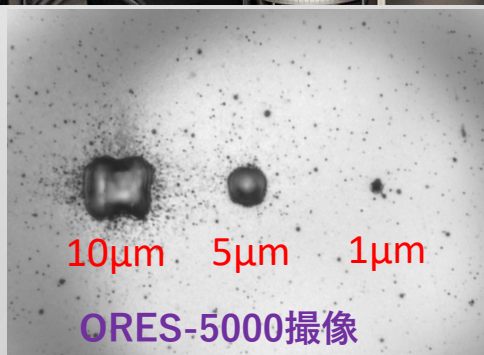
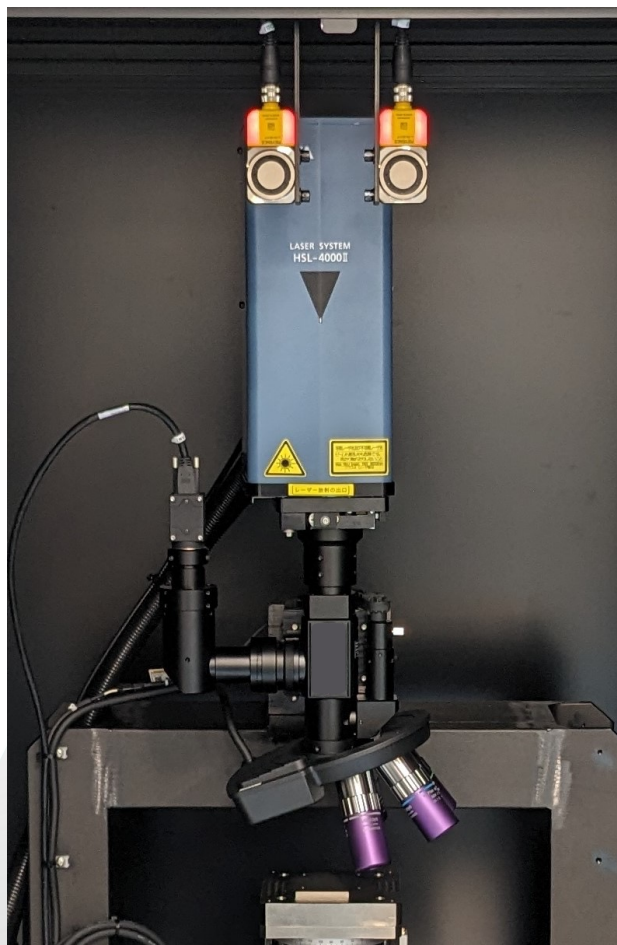


# 微細レーザー露光・加工装置 ORES-5000 シリーズ



—ORES (Optical fine REsolution lithography System)とは—  
超微小径のレーザー源、高精度ステージ及び高解像度の光学システムにより、超精密な加工・露光処理を実現します。

# ORES-5000シリーズ

## 主な機能

- ・ 観察画像を見ながら、マニュアルで加工が可能。
- ・ モニター上の観察画面にて、ワークの基準位置(例:原点、右下、右上)をクリックすることで位置補正処理/自動アライメント可能。
- ・ CADデータのインポート機能や編集機能も対応可能。  
※オプション

レーザー基本仕様	
最小照射径	0.8 $\mu$ m～ ※対物レンズスペックに依存
照射エネルギー	0.5～10.0mJ
照射波長	266nm/355nm/532nm/1064nm ※何れか選択可
スリット	角型
発振方式	空冷YAG/水冷YAG
波長吸収特性による加工適合性	
266nm	クロム (Cr) 、アルミ (Al) 、ITO、 モリブデン (Mo) 、 シリコンナイトライド、ポリイミド、 RGB_CF及びCF上オーバーコート
355nm	クロム (Cr) 、アルミ (Al) 、ITO、 モリブデン (Mo) 、 シリコンナイトライド、ポリイミド、 TFT配線の溶接、 RGB_CF及びCF上オーバーコート
532nm	クロム (Cr) 、アルミ (Al) 、ITO、 銅 (Cu) 、金 (Au) 、チタン (Ti) 、 ニッケル (Ni) 、ニッケルクロム、 チタン・タングステン、 TFT配線の溶接、 RGB_CF及びCF内の不純物、 CF上オーバーコート、 ポリシリコン
1064nm	クロム (Cr) 、アルミ (Al) 、ITO、 ニッケル (Ni) 、 TFT配線の溶接、 RGB_CF及びCF上オーバーコート、 ポリシリコン

# ORES-5000シリーズ

観察系・光学系仕様	
レンズ倍率	10~150倍 ※明視野・暗視野・各波長対応 ※高NA、高倍率カスタム可能
観察倍率	総合倍率で12,000倍
レンズWD	10mmなど ※様々なWDのご要望にも対応可能
レンズ焦点距離	2mm~
レンズ搭載数	2~6本
同焦点距離	標準95mm ※対物レンズに依存
デジタルズーム	有り
装置・ステージ制御系仕様	
ステージサイズ	□100mm ※カスタム対応可能
ステージ軸	X Y Z $\theta$ 4軸搭載
XYステージ分解能	16nm (軸毎繰り返し精度: $\pm 0.08\mu\text{m}$ )
Zステージ分解能	1nm (ストローク $\pm 2.5\text{mm}$ )
$\theta$ ステージ	$\pm 135^\circ$ (角度分解能: $0.000016^\circ$ )
多孔質吸着ステージ	※オプション
防振機構	標準搭載

※ステージ仕様は、ワークサイズや環境対応など、様々なカスタム対応が可能。